METHOD AND EQUIPMENT FOR REMOVING STATIC CHARGE BY CLEANING WITH WATER UTILIZED THEREFOR

Publication number: JP2203976 (A) Also published as: Publication date: 1990-08-13 DJP2921762 (B2) Inventor(s): YONEHARA TAKASHI + Applicant(s): YONEHARA TAKASHI + Classification: **B05D1/02; B05D3/10; B08B6/00; H05F3/04; B05D1/02; B05D3/10; B08B6/00; H05F3/00;** (IPC1-7): B05D1/02; B05D3/10; B08B6/00; H05F3/04 - international: - European: Application number: JP19890019726 19890131 Priority number(s): JP19890019726 19890131 Abstract of JP 2203976 (A) PURPOSE:To efficiently remove electricity by atomizing the specified amount or more of water at the rate of the specified atomizing pressure or more and atomizing the water as mist having specified particle size to a material to be treated. CONSTITUTION: Proper water is filtered and thereafter treated by ion exchange resin to produce pure water. This pure water is sent to a pure water supply pipe 5. A plastic film 11 being the material to be treated is transferred near to the opening part 2a of a hollow part 2 and dust is removed by the air sucking pipes 10. Then the plastic film is positioned under the opening part 2a of the hollow part 2 and the valve 6a of an air supply pipe 6 is opened. Mist 12 of pure water is atomized through the injection port 3a of a nozzle 3. Mist 12 is atomized at the rate of >=1ml/min quantity, >=1.0kg/cm<2> atomizing pressure and >=20l/min quantity of air.; Particle size of mist is regulated to <=50mum and the mist is intensively electrified. Thereby static charge on the surface of the film is removed. Data supplied from the espacenet database - Worldwide

⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-203976

⑤Int. Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 ❸公開 平成2年(1990)8月13日 B 08 B B 05 D 6/00 7817-3B 1/02 3/10 3/04 Z F Z 6122-4F 6122 - 4FH 05 F 7028 - 5G審査請求 未請求 請求項の数 7 (全10頁)

②特 願 平1-19726

22出 願 平1(1989)1月31日

⑩発 明 者 米 原 降 東京都:

個代 理 人 弁理士 藤沢 正則 外2名

明 和 著

1,発明の名称

水を用いた除電クリーニング法及びその装置 2、特許請求の範囲

- (1) 1 m 2 / 分以上の分量の水を噴霧圧1.0 kg/cf以上の割合で噴霧し、粒径約50 μ以下のミストにし、これを被処理体に噴霧することを特徴とする、水を用いた除電クリーニング方法。
- (2) 1ml/分以上の分量の水を噴霧圧1.0kg/cf 以上の割合で噴霧し、粒径約50μ以下のミストにし、これを被処理体に噴霧するとともにこれらの噴霧中のミストを温風又は熱線雰囲気中に通びが大きな変響を1ml/分以上の分量を噴霧圧1.0kg/cf 以上の分量を噴霧圧1.0kg/cf 以上の分量を噴霧圧1.0kg/cf 以上の分量を噴霧圧1.0kg/cf 以上の分量を噴霧圧1.0kg/cf 以上の分量を噴霧圧1.0kg/cf 以上の分量を噴霧圧1.0kg/cf 以上のかった、上記界面にしてで噴霧し、粒径約50μ以下のミストにしてれた破処理体に噴霧後気にするよう噴霧中のミストを複処理体に噴霧後気にするよう噴霧中のミストを温風又は熱線雰囲気中に通すことを特徴とする、

水を用いた除電クリーニング方法。

- (4) 水を粒径約50 µ 以下のミストにし、このミストのイオン化を適宜の手段で促進させて被処理体にこれを噴霧するとともにこれらの噴霧中のミストを温風又は熱線雰囲気中に通すことを特徴とする、水を用いた除電クリーニング方法。
- (5) ミストのイオン化を促進させる手段が、ミストに電界又は電場を与えるものであることを特徴とする、特許請求の範囲(4)項記載の水を用いた除電クリーニング方法。
- (6) ミストのイオン化を促進させる手段が、純水から成るミストとしたことを特徴とする、特許請求の範囲(4)項記載の水を用いた除電クリーニング方法。
- (7) 下前が開口した、断前略椀状の中空部を有する装置本体の中空基部に、水を粒径約50 μ以下のミストにして中空部の開口部に向けて喉霧するミスト喉鰯口を設け、このミスト噴鰯口の周囲の中空部内壁に、温風又は熱線噴出口を多数設けたことを特徴とする、水を用いた除電クリーニング装

震。

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は帯電している合成樹脂等の物や人体、 動物、空気等の除電及び除塵を主な目的とした除 電クリーニング法及びその装置に関するものであ る。

(従来の技術)

プラスチック成型品、フィルム、紙、布等のものの印刷加工する際に除電をして静電気を取り、ホコリを取り除かなければならない。そこで従来は5KV~10KVの高電圧放電によりコロナ放電を行いイオン風を被処理物に吹き付けて除電している

(発明が解決しようとする課類) .

しかしながらこの方法の場合、被処理物に付着 しているホコリは電気的には中和されていて、表 面には電荷が現れない。それは被処理物表面に帯 電している微粒子が付着すると、被処理物表面に 静電誘導現象により逆の極の等量の電荷が誘起し

- 3 -

気に通して粒径を小さくしつつ被処理体に当てる 除電除塵方法及びその装置を提供するものである。

また翻求項第4項乃至第6項の発明は水を粒径 約50 µ以下のミストにし、このミストのイオン化 を適宜の手段で促進させて被処理体にこれを噴霧 するとともにこれらの噴霧中のミストを温風又は てしまい、見かけ上電荷は等となり、バランスがとれ、安定し、強固に固定される。これにイオン 風を吹き付けてもこの付着している、見かけ上帯 電圧零の微粒子に対しては電気的には全く影響を 与えない。 従って付着しているホコリ等の微粒子 に対しては純電気的な放電による静電気乃至はホ コリの除去は難しい。

この様にコロナ放電による除電の場合空気中に 浮遊している粒子に対しては除電効果があるが、 被処理物表面に固定されている粒子に対しては除 電効果は著しく阻害される。また電子機器等は内 部のIC等の半導体が静電放電等による電磁波に よって破壊され易いため、このコロナ放電による 除電は向かない。

従って被処理物の帯電を完全に除電するのはかなり難しいものである。

(課題を解決するための手段)

そこでこの発明は上記コロナ放電に代えて、水 を用いてこれを多数の徴粒子にしてミストを一部 イオン化し、これらのミストを温風又は熱線雰囲

- 4 -

熟線雰囲気中に通して成る除電クリーニング方法 であり、第5項の発明は上記ミストのイオン化促 進手段として噴霧中のミストに電界又は電場を与 えるものであり、第6項の発明は上記ミストのイ オン化促進手段として水の純度を高めて抵抗値を 上げ、イオン化を促進させるものである。また上 記ミストのイオン化促進方法としては他にイオン 風をミスト中に送り込むとか、磁場を与えてこの 中をミストを通過させるとか、ミスト中に遊赤外 線又は紫外線を照射させるとか、超音波の発振域 中をミストを通過させるとか、超音波を与え乍ら ミストを噴霧させるとか、ミストにする際エアー の代わりに炭酸ガス等の酸性ガス又はアンモニア 等のアルカリ性ガスを吹き付けてミストとする等 の手段がある。さらに請求項第7項の発明は下面 が開口した、断面略椀状の中空部を有する装置本 体の中空基部に、純水を粒径約50μ以下のミスト にして中空部の開口部に向けて噴霧するミスト噴 霧口を設け、このミスト噴霧口の周囲の中空部内 壁に、温風又は熱線噴出口を多数設けた除電クリ

ーニング装置である.

この水のうち通常の水は抵抗値が約 $2\sim5\times10^3$ Ω 程度、全カチオン300PPMであるのに対し、イオン交換樹脂で処理した純水は抵抗値約 10^5 Ω 、全カチオン0.5PPM程度のものである。

(作 用)

- 7 -

また請求項第2項の発明は上記請求項第1項の ものとほぼ同様に作用するが、噴霧中のミストが 温風又は熱線雰囲気を通るため、ミストの粒子は 次第に気化してその粒径を小さくしながら被処理 体にぶつかって付着し、直ちに蒸発する。従って

リ等の徴粒子(ロ)にミストの上記電荷と逆の極の 電荷を有する微粒子(ハ)が当り、これが被処理体 (イ)の表面に誘導された逆極の等量の電荷(二)に 対してより誘電率の高い水の粒子のため微粒子 (口)の電荷は微粒子(ハ)の電荷に誘導され、この 徴粒子(ハ)が蒸発する時、電荷とともに消滅し、 第1図(C)に示す如く、電荷を有しないホコリ第 の微粒子(口)のみが残る。またこれはミストの電 荷を有しない微粒子(ホ)が第1図(B)に示す如く 電荷を有するホコリ等の微粒子(ロ)に当った場合 でも、微粒子(ホ)に静電誘導により逆極の電荷が 誘起され、被処理体(イ)の装而に誘導された逆極 の等量の電荷(二)に対してより誘電率の高い水の 粒子のために微粒子(口)の電荷は微粒子(ホ)の電 荷に誘導されて、この微粒子(ハ)が蒸発する時、 電荷とともに消滅し、第1図(C)の如くなる。こ れは液体の微粒子の気化による電荷の熱エネルギ 一への転換作用によって電荷はエネルギーの形を 変えて空中へ気化、消滅する。勿論被処理体表面 に存する静電気(へ)は第1図(D)に示す如く上記

- 8 -

電子機器等の水に溺れては困るものでも、この方 法に拠れば回路部品の絶縁破壊を起こすこと無く 除電、除腺ができる。

また請求項第3項の発明は上記請求項第2項の ものとほぼ同様に作用するが、上記ミストを構成 する水に極く値かの界面活性剤や電荷移動針化等 の物質を混ぜているため、これらのミストの各徴 粒子が被処理体表面に付着した際より帯電電荷が 移動し易く、除電効果が高い。しかしながら混ぜ た界面活性剤は極く僅かで、かつミスト噴霧中に 加温しているため、彼処理体へ付着後気化し、除 電処理後被処理体表面から除去し、従って表面に は何も残らない。また請求項第4項乃至第6項の 発明は上記請求項第2項のものとほぼ同様に作用 するが、噴霧するミストのイオン化を促進させる もので、より多くのミストの微粒子をイオン化さ せ被処理体表面の除電効果を高めるものである。 さらに請求項第7項の除電クリーニング装置は装 耀本体の開口部に近接して被処理体を当て、ミス ト噴霧口からミストを噴霧する。すると一部の粒

子は装置本体の中空部内でイオン化し、 帯電する。 という では 対 い は 対 い は 対 に は 対 が に は 対 数 解 類 田 し た 多数 解 類 田 し た と 教 数 か 日 し た と 教 が 気 化 し し か ら の を を を 薬 発 に 被 処 理 体 の 表 面 に 付 者 し た ま で き で き 付け た り 、 吸 引 し た り し た い ま の の に は も は や 帯電 し て お ら の ま に は も は や 帯電 し て お ら の い し た り し た り す れ ば 容 易 に は も は や 帯電 し て お ら で き で き の 彼 粒 子 で き の 彼 粒 子 を 吹 き 付け た り 、 吸 引 し た り す れ ば 容 易 に ホ コ リ 等 の 彼 粒 子 を 吹 き 付け た り 、 吸 引 し た り す れ ば 容 易 に ホ コ リ 等 の 彼 粒 子 を 吹 き る 。

また上記ミストは水から成るため、被処理体の 表面に吹き付け、これらが蒸発すると表面には何 も残らず吸湿性の強いナイロンフィルム等の被処 理体の場合でも変形することなく、クリーンな状 態となる。

(実施例)

以下この発明の実施例を第2図以降につき説明する。

- 11 -

2図の右方のエアー吸引管10よりプラスチックス フィルム11上のある程度のホコリを取り除く。そ して第2図矢印Aに示す如くプラスチックスフィ ルム11を移送させ、上記中空部2の開口部2a下 に位置させ。そこで上記エアー供給管 6 のパルブ 6 a を開き、ノズル3の噴出口3 a から純水のミス ト12を噴霧させる。このミスト12は 1 m l / 分以上 の分量を噴霧圧1.0 kg/cfl以上、エアー量20.0/分 以上の割合で噴霧させる。この噴霧されたミスト の粒径は50μ以下であり、これらのミストは噴霧 に際して空気摩擦によって強力に帯電する。さら に温風供給管9から温風路7を介して各温風噴出 口8から温風を中空部2内に送り込む。これによ り中空部2内は全体が40℃前後の加熱雰囲気とな る。従って噴霧された上記ミスト12の各微粒子は この加熱雰囲気中を通過し、この中で各徴粒子は 外周が気化して粒径を小さくしつつ加速されて落 下し、プラスチックスフィルム11上にぶつかる。

このぶつかった各徴粒子は粒径が小さくかつ加 温されているため直ちに蒸発する。これによりプ 第2図はこの発明の第1実施例の装置を示し、 1は装置本体、2はこの装置本体1の下面に開口 部2aを有する断面略挽状の中空部、3はこの中 空部2の上部中央に噴出口3aを突出せしめて装 置本体1に支持固定したノズル、5は装置本体1 外からこのノズル3に一端を接続した純水供一端 6は同じく装置本体1外からこのノズル3に一の内 局に沿って装置本体1内に設けた温風踏出口、8は上 配中空部2の内層に多数設けた温風踏出口、9は に中空部2の内層に設けた工戸一 機管、10は装置本体1の両側に設けたエアー映 出管である。

次にこの装置を用いてこの発明の方法を説明する。適宜の水をろ過し、イオン交換樹脂で処理して電気抵抗値10°Ω以上及び全カチオン0.5PPM以下の純水とする。この純水を純水供給管5に図外のポンプ等で送る。一方装置本体1の下方、上記中空部2の開口部2aに近接して被処理物たるプラスチックスフィルム11を移送させる。そして第

- 12 -

ラスチックスフィルム11の表面の静電気は除去される。そしてさらにプラスチックスフィルム11を矢印Aの方向に移送させ、エア一吸引管10によりプラスチックスフィルム11上に付着した、もはや移動し易くなった電荷のないホコリ等の微粒子を吸引し、当該プラスチックスフィルム11の表面をクリーンにする。

なおこの実施例に代えて水に対し6%以下の分 量の界面活性剤、電荷移動餅体等の電荷を移動で きる物質を加えたものをミストにし、これを破器 せしめる場合もあり、これによればミストの各で 粒子が被処理体の表面に付着した際、より帯電電 荷が移動し易く、除電効果が高い。しかし混ぜた 界面活性剤は極く低かであるため、かつミストを 界面活性剤は極かであるため、除電処理後 処理体表面に昇面活性剤が何も残らない。

第3図はこの発明の第2実施例を示すもので、 噴鰯するミストのイオン化を促進させて被処理体 にこれを噴霧し、除電を行う方法の一例を示した ものである。この方法に使用する装置は上紀第1

る。

実施例のものとほぼ同一であり、さらにノズル3 の噴出口3aの下方に近接して二つの電極13、13 を突出せしめ、これらの電極13、13に直流又は交 流の高電圧をかけ、噴霧されたミスト12のイオン 化をより促進せしめるものである。このイオン化 促進方法としては上記第1実施例において温風供 給質9から供給する温風内にイオン風を送り込む もの。また上記ノズル3の噴出口3aの下方に永 久磁石又は電磁石を設けて磁場をつくり、この磁 場に噴霧したミストを通過させるもの。また上記 実施例における中空部2の内周面をセラミックス 等で被い、このセラミックスにより遠赤外線を発 射させ、噴霧されたミストに遠赤外線を照射させ る。また中空部2内で、噴霧されたミストに紫外 線を照射させるとか、超音波を与えながらミスト を噴霧させるとか、純水等をミストにする際エア 一の代わりに、炭酸ガス等の酸性ガス又はアンモ ニア等のアルカリ性ガス、さらには酸化しやすい 材料の場合アルゴン、ヘリウム等の不活性ガスや 窒素ガスを吹き付けてミストとする等の手段があ

第4回はこの発明の第3実施例を示し、箱体型 の装置本体20の下部に純水を入れたタンク21を設 け、このタンク21の上方の棚部22に設けたノズル 23にタンク21の純水を導入し、一方圧縮エアーを パルブ24を介してエアー供給管25を通し、ノズル 23に供給する。これによりノズル23の噴出口23a から純水のミスト26が装置本体20の上部に設けた ミスト発生室27内に噴霧される。このミスト26は 3ml/分以上の分量を噴霧圧5kg/cmi、エアー量 60 Q / 分の割合で噴霧させる。このミスト26の粒 径は50μ以下であり、喷霧に際して空気摩擦によ って強力に帯電する。そして装置本体20の外部に 設けたエアーブロアー28で吸引したエアーをヒー ター29を通して約60℃の温風とし、この温風を装 置本体20の上部に送り、ミスト発生室27の側壁周 囲に多数設けた温風噴出口30からミスト発生室27 に噴出させ、ミスト発生室27に一端を接続して装 置本体20外部へ導出したダクト31内に、ミスト26 を加温しながら移送する。そして被処理体にこれ

- 15 -

第6図乃至第10回はこの第3実施例における噴霧装置32の具体例を示すもので、第6図の噴霧装置32′は上記ガイド体33を横長にしたもので、シート、フィルム、板物、紙等の除電処理に適するものである。

- 16 -

また第7図のものはコンベアーベルト36に設けたゲート型の噴霧装置37としたもので、これはコンベアーベルト36上に成型品、梱包品等をのせ、これらを噴霧装置37にくぐらせ、該筋所でミストを噴霧し、除電するものである。この場合この噴霧装置の脇に適宜の吸引装置(図示省略)を設け、除電されたホコリ等の徴粒子を吸引除去することもできる。

ヤワーノズル状の噴霧装置44であり、これを作業者が手で持って、適宜の被処理物に吹き付けるものである。このシャワーノズル状の噴霧装置44の噴霧口面45に温風、ビーター等により赤外線を発する赤外線放射体53を設けてもよい。

また第11回はこの発明の第4実施例のシャワーノズル状の噴霧装置46を示すものであるが、この実施例のものはラッパ状本体47の内周面中央基部に、ミストを噴霧する噴霧ノズル48を設け、この噴霧ノズル48には水供給管49及びエアー供給管50を導入し、このラッパ状本体47内には温風を導入し、上記噴霧ノズル48の周囲のラッパ状本体47内周面に多数設けた噴出口52から温風を噴出せしめるものである。

次に上配第2図に示した第1実施例の装置を用いてこの発明の除電方法で除電した結果を示す。 上記第1実施例の装置本体1の開口部に当てる被処理体は厚さ30μ、巾600mmのポリプロピレンフィルムであり、処理スピード35m/分で移送した。また水道水をイオン交換樹脂で処理して抵抗値

- 19 -

0.01PFに低下した。

また次に第11図のシャワーノズル状の噴霧装置 46を用いて、抵抗値 10° Ω の純水を $100\sim500$ $_{\odot}$ ℓ / 分の割合で、エアー量 $100\sim500$ ℓ / 分、噴霧圧 5 kg/cm で粒径10 μ のミストを噴霧し、50 $\mathbb C\sim60$ $\mathbb C$ の温風を $200\sim800$ ℓ / 分の分量で吹き付け、 $3\sim8$ m 先の天井、壁面を 1 m 当り約 1 秒の割合でミストを噴霧したところ帯電圧は3,000 V から $100\sim60$ V に低下した。

(発明の効果)

この発明は以上の構成であり、請求項第1項の が発明は、水を用いてこの水を徴粒化に際しての帯電を利用し、イオン化したミストを被処理体にでいまし、これらの水の徴粒子を被処理体に当じ、これらの水の徴粒子が蒸発気化することにより、これと一緒に帯電電荷を空中に気化、消滅させ、被処理体を除電するものである。従って従来のコウ放電によるイオン風よりも水のイオン化した徴せの方が多極化されかつ極めて大きく、除電能力は高い。それ故被処理体に付着したゴミやホコ

10° Qの純水とし、この純水を20m 2/分の分量で噴霧圧2.5 kg/cfでノズル3から粒径10μのミストを噴霧し、温風を温風供給管9から150m 2/分の割合で供給し、温風噴出口8から40℃の温風を吹き付けた。上記ノズル3の噴出口3aから上記被処理体までの距離は約1mとした。この結果上記ポリプロピレンフィルムは、除電処理前は帯電圧30,000~50,000 V であったが、これが処理後100 Vに低下した。また3mmの距離からの灰付着テストでは灰の付着が0であった。これは除電処理後0の帯電圧が1K V 以下の実用的範囲に十分入っているものである。

また上記第11図のシャワーノズル状の戦器装置46を用いて人体の除電を行った。これには抵抗値10°Ωの純水を用い、この純水を90mℓ/分の分量で、エアー量200mℓ/分、噴霧圧3.5㎏/cdで粒径10μのミストを噴霧し、同時に40℃の温風を200mℓ/分の分量で吹き付け、これをミストの噴霧距離50cmで約2秒間行ったところ、帯電圧600 V、静電容量150PFの人体が帯電圧300 V、静電容量

- 20 -

リ等の帯電徴粒子に対しても除電できる。しかも この発明では被処理体に付着した水の微粒子の空 気中への気化に伴い帯電電荷が消滅するため、被 処理体周囲は局部的に湿度が高まり、いわゆる静 電放電による電磁隙害が発生しない。従って能子 機器等は内部のIC等の半導体が静電放電による 電磁波によって破壊され易く、それ故コロナ放電 が向かなかったが、この発明の除電方法を用いれ ば安心して除電できる。またこの発明では水の微 粒子をミストにして彼処理体に付着させ、これを 気化せしめているため、除電した被処理体の表面 には薬剤や化学剤が残らず、被処理体自体の特性 が変わることがない。その点上記水の純度を高め れば高める程不軛物が被処理体表面に残らない。 この様に水の徴粒子を気化させるものであるが、 被処理体の材料によっては水の分子的な膜が表面 に形成され、これが表面を活性化し、印刷、塗装、 接着等の場合、これらが極めて付着、固定し易く なる。また被処理体が紙等の機維質のものはこれ らの分子的な水の膜によって強度が増す。

また一般に空気中に浮遊している雑菌類(大腸 菌、ブドウ状球菌等のバクテリアとかカビ類)は 帯電しているホコリ等の微粒子に付着し、その電 気的反発力を利用して会合せずに互いに安定した 距離を維持している。この雰囲気に従来のイオン 風を送り込んでもイオン風が単一電荷のため除電 効果が少なく、かつ上記菌類の付着している、数 ミクロン以下のホコリ等の微粒子はイオン風の影 響を受けない。しかしながらこの発明の除電方法 によれば、水の微粒子が上記函類の付着したホコ り等の微粒子に付着し易く、かつこれらの微粒子 相互も凝集し易く、従って菌類相互が接触し、抗 体がないためどちらか一方の強い方が残り、この ためこれを繰り返すことによって歯類が極めて少 なくなり、残存していないに等しい状態となる。 従ってこの除電処理により衛生的な空気が得られ、 特に衛生的な状態を要する部屋の除電除塵に適し ている。

また諸求項第2項の発明は上記のものに加え上 記噴霧中のミストを温風又は熱線雰囲気中に通す

- 23 -

第1図(A)、(B)、(C)、(D)、(E)は夫々この発明の原理説明図、第2図はこの発明の第1実施例の断面図、第3図はこの発明の第2実施例の断面図、第4図はこの発明の第3実施例の装置本体の断面図、第5図は同実施例の噴霧装置の断面図、第6図乃至第10図は夫々同実施例の噴霧装置の具体例を示す斜視図、第11図はこの発明の第4実施例の噴霧装置の断面図である。

なお図中1は装置本体、2は中空部、3はノズル、5は純水供給管、6はエアー供給管、7は温風路、8は温風噴出口、10はエアー吹出管、11はプラスチックスフィルム、12はミスト、21は純水タンク、23はノズル、25はエアー供給管、26はミスト、27はミスト発生室、28はエアーブロアー、

ため、ミストの各徴粒子は加温されて一部は気化 してその粒径を小さくしながら被処理体にぶつか り、直ちに蒸発する。従って被処理体がぬれるこ とがない。

また結求項第3項の発明は上記水に界面活性剤や電荷移動錯体等の電荷を移動できる物質を換く僅か混ぜた溶液をミストとしているため、ミストの各粒子が被処理体表面に付着した際、より帯電電荷が移動し易く、除電効果が高い。しかしながら除電処理後には被処理体表面にこれらの物質が残らない。

また請求項第4項乃至第6項の発明は水から成るミストのイオン化を促進させて被処理体に噴霧する除電方法であるが、その一例としては水の純度を高め、電気抵抗値を上げることにより、ミスト化する際の帯電を強め、これにより多くのミストの微粒子を強力に帯電化させ、これらの微粒子を帯電している被処理体表面に当てることにより除電効果を高めるものである。

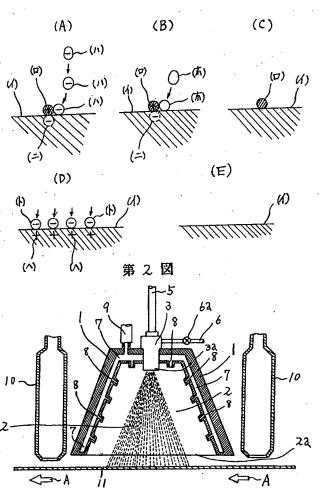
また請求項第7項の除電クリーニング装置は機

- 24 -

29はヒーター、30は温風噴出口、31はダクト、32 は噴霧装置、33はガイド体、34は温風供給管、35 は温風噴出口である。

特 許 出 願 人 米 原 隆
代 理 人 弁理士 滕 沢 正 則
代 理 人 弁理士 滕 沢 則 昭





第3図

